

## ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕРХРЕШЕТОК PbTe—Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te

Апатская М. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В., Ушакина Н. Н.

В сверхрешетках PbTe—Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te исследованы угловые зависимости поперечного магнитосопротивления, вольтамперные характеристики, дифференциальная емкость и дифференциальное сопротивление. Получены доказательства двумерности электронного газа. Найдено, что дифференциальная емкость сверхрешеток значительно меньше емкости диодных структур.

Сверхрешетки (СР) на узкощелевых полупроводниках A<sup>IV</sup>B<sup>VI</sup> вызывают значительный научный и прикладной интерес в связи с перспективами их использования в ИК технике [1]. Для получения СР на основе A<sup>IV</sup>B<sup>VI</sup> в настоящее время, как правило, используют относительно простой метод «горячей стенки», а также метод молекулярно-лучевой эпитаксии [1, 2]. СР PbTe—Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te относят к типу I с контравариантной модуляцией зон [2]. Носители в таких СР заключены в квантовые ямы, образованные слоями Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te. Движение носителей в таких ямах должно носить двумерный характер.

Для наблюдения двумерной проводимости необходимо, чтобы при движении носителей вдоль оси СР было выполнено условие  $l \gg d$ , где  $d$  — толщина слоя Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te,  $l$  — длина свободного пробега носителей (в Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te при  $T=77$  К типичное значение  $l \approx 1000$  Å).

В настоящей работе исследованы электрофизические свойства СР PbTe—Pb<sub>0.8</sub>Sn<sub>0.2</sub>Te *n*- и *p*-типа, выращенных на подложках BaF<sub>2</sub> методом горячей стенки. Толщина буферных слоев PbTe или Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te составляла  $\sim 1\text{--}2$  мкм. СР представляли собой композиционные структуры из 10—20 чередующихся слоев *n*-PbTe и *p*-Pb<sub>0.8</sub>Sn<sub>0.2</sub>Te с толщинами  $d \approx 500 \pm 800$ ,  $200 \pm 330$  Å соответственно и имели холловскую конфигурацию для выполнения измерений явлений переноса. Периодичность распределения компонент Pb и Sn по толщине СР исследовалась с помощью снятия оже-профилей при послойном стравливании ионами аргона на оже-спектрометре 09ИОС-10-005. Ранее на подобных СР квантование спектра носителей было показано в исследованиях оптического пропускания и спектров фотоответа [3, 4].

Доказательства существования двумерной проводимости в СР были получены из измерений угловых зависимостей магнитосопротивления и вольтамперных характеристик при температуре 77 К. Также были измерены дифференциальная емкость и дифференциальное сопротивление СР в зависимости от величины и знака приложенного смещения.

Измерения поперечного магнитосопротивления (ПМС) были выполнены в слабых магнитных полях при условии  $\mu H/c < 1$  [ $\mu$  — подвижность носителей тока (в см<sup>2</sup>/В·с),  $H$  — напряженность магнитного поля (в Г),  $c = 10^8$  см/с]. Подвижность носителей найдена из измерений постоянной Холла и удельного сопротивления при протекании тока в плоскости слоев СР. Результаты измерений ПМС показаны на рис. 1. Для сравнения на этом же рисунке приведены угловые зависимости ПМС в пленке Pb<sub>0.8</sub>Sn<sub>0.2</sub>Te толщиной  $\sim 4$  мкм. Интерпретация экспериментальных результатов по ПМС в пленках (трехмерная проводимость), выращенных на подложках BaF<sub>2</sub> в направлении (111), должна проводиться с учетом существования в пленках деформаций сжатия из-за несоответ-

ствия постоянных решеток  $a_0$  подложки и пленки [ $a_0$  ( $\text{BaF}_2$ ) = 0.6200 нм,  $a_0$  ( $\text{Pb}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{Te}$ ) = 0.64321 нм] и их температурных зависимостей. Соответствующая теория ПМС была разработана в [5]. В обозначениях работы исследования ПМС в пленках и СР выполнены в конфигурациях *B* и *C* (рис. 1). Выражение для ПМС имеет вид

$$\Delta\rho/\rho_0 = M_\theta^\varphi (\mu H/c)^2, \quad (1)$$

где коэффициент  $M_\theta^\varphi$  является функцией углов  $\theta$  и  $\varphi$  (см. вставку на рис. 1), а также зависит от механизмов рассеяния носителей тока, анизотропии эффективных масс, степени вырождения и т. п.  $M_\theta^\varphi$  для пленок рассчитывались согласно [5] при следующих значениях коэффициентов:  $b=0.12$ ,  $d=0.68$ ,  $d'=0.8$ ,  $c'=-0.24$ , которые являются типичными для полупроводников  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  [5, 6]. При  $T=77$  К величина  $\mu H/c$  равнялась 0.33 для пленки

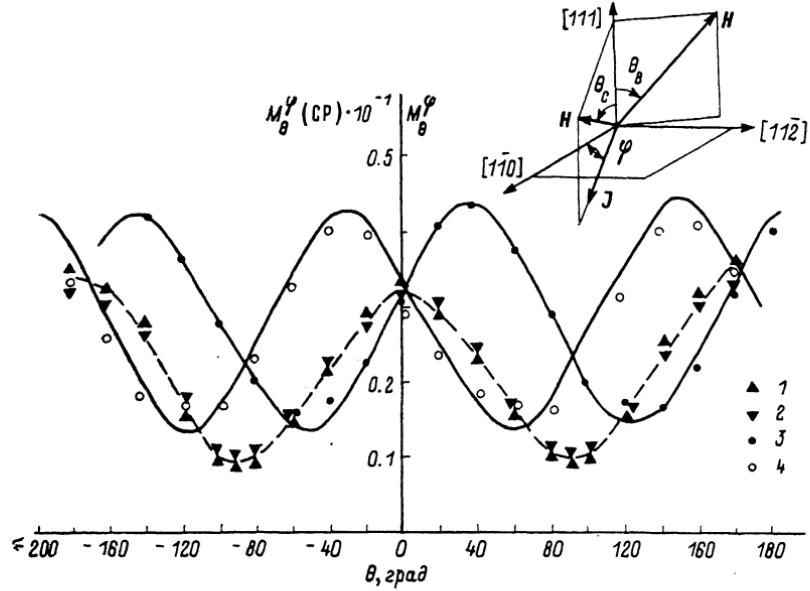


Рис. 1. Угловые зависимости коэффициента магнитосопротивления в сверхрешетке [ $M_\theta^\varphi$  (CP)] и пленке  $\text{Pb}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{Te}$  [ $M_\theta^\varphi$ ] *p*-типа проводимости.

Измерения в конфигурации *B* (1 — сверхрешетка, 3 — пленка) и *C* (2 — сверхрешетка, 4 — пленка). Сплошные линии — расчет  $M_\theta^\varphi$  при  $\varphi=45^\circ$ . На вставке показана геометрия опыта. Холловская концентрация носителей тока  $p_{\text{ср}}=5.7 \cdot 10^{17}$  и  $2.95 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$  в сверхрешетке и пленке соответственно.

и 0.35 для СР. Существенно, что теория ПМС предсказывает конечное значение  $\Delta\rho/\rho_0 > 0$  в пленках при любых значениях угла  $\theta$  между направлением магнитного поля и плоскостью пленки. Напротив, при наличии двумерной проводимости [6]  $\Delta\rho/\rho_0 = P \cos^2 \theta$ . Видно, что при значениях  $\theta$ , кратных  $\pi/2$ ,  $\Delta\rho/\rho_0=0$  ( $P$  — постоянная величина).

При изменении конфигурации измерений угловая зависимость ПМС в пленках существенно изменилась, что находится в соответствии с теорией [5]. В то же время угловая зависимость ПМС в СР для обеих конфигураций оставалась неизменной, что может служить доказательством существования двумерной проводимости. Отсутствие «зануления» ПМС в минимумах угловой зависимости может быть связано с наличием толстого буферного слоя ( $d_{\text{буф}}=1 \div 2$  мкм), проводимость в котором носит трехмерный характер, влияние его, однако, относительно мало в связи со значительно большим МС в СР. Коэффициент магнитосопротивления в СР практически на порядок величины превосходит значение  $M_\theta^\varphi$  в пленках, что связано с анизотропией времени релаксации  $\tau$  носителей тока [7]. Носители с разных участков поверхности Ферми обладают разным временем релаксации, что даже в случае вырождения приводит к наличию значительного ПМС в СР.

Доказательством двумерного характера движения электронного газа могут служить ВАХ и ВФХ. На рис. 2 показаны ВАХ СР при протекании тока вдоль оси (1) и в плоскости слоев (2). Как видно из рисунка, наблюдается резкая анизотропия ВАХ. При прохождении тока в плоскости слоев ВАХ не отличается от омических  $J$  ( $V$ )-характеристик пленок. По внешнему виду и абсолютным значениям токов ВАХ, показанные на рис. 2, подобны обратным ветвям вольт-амперных характеристик гетеропереходов  $\text{PbTe}-\text{Pb}_{0.8}\text{Sn}_{0.2}\text{Te}$ , ток в которых обусловлен туннельным прохождением носителей через барьер [8].

Зависимости дифференциального сопротивления  $R$  и дифференциальной емкости  $C$  в СР от смещения вдоль оси СР показаны на рис. 3. Дифференциальная емкость измерялась на частоте тестирующего сигнала 1 МГц. Максимумы на кривых  $R$  ( $V$ ) и  $C$  ( $V$ ) расположены вблизи нулевых смещений. Кроме того,

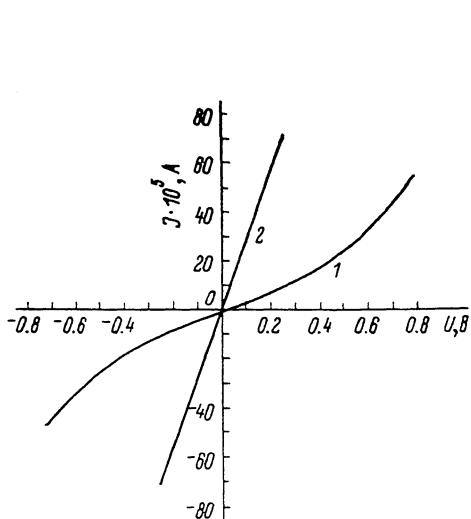


Рис. 2. ВАХ сверхрешетки  $p$ -типа при  $T=77$  К, измеренные при протекании тока вдоль оси (1) и в плоскости слоев (2).

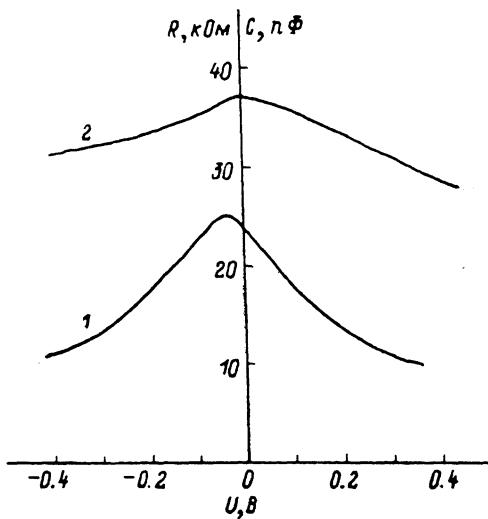


Рис. 3. Зависимость дифференциального сопротивления  $R$  (1) и дифференциальной емкости  $C$  (2) в сверхрешетке  $p$ -типа при  $T=77$  К в зависимости от смещения, приложенного поперек слоев.

Площадь слоев сверхрешетки  $A=3 \cdot 10^{-3}$  см $^2$ .

они имеют почти симметричный вид, что отличает их от аналогичных зависимостей в диодных структурах.

Удельная дифференциальная емкость СР примерно в 50—100 раз меньше, нежели в диодных структурах [типичные значения  $C/A$  в  $p-n$ - и гетероструктурах на основе  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  ( $x=0.2$ ) составляют  $\sim 10^6$  пФ/см $^2$ ]. В то же время произведение дифференциального сопротивления при нулевом смещении  $R_0$  на площадь  $A$  в СР примерно в 5—10 раз выше, что позволяет значительно понизить ограничения быстродействия фотовольтаических приемников на основе  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  за счет уменьшения постоянной времени  $RC$ -цепочки, связанной с большой емкостью  $p-n$ - и гетеропереходов на основе  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ . Малые значения дифференциальной емкости обусловлены малым изгибом зон в СР по сравнению с гетеропереходами  $\text{PbTe}/\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  и большим количеством барьеров, соединенных последовательно. В  $p-n$ -переходах с толстой базой дифференциальная емкость связана с движением слоя объемного заряда при изменении внешнего смещения, что не имеет места в СР.

Симметричный вид зависимостей  $R$  ( $V$ ) и  $C$  ( $V$ ) свидетельствует о симметричном характере электростатического модулирующего потенциала СР и отражает возможность получения качественных структур. Это важно в связи с методом горячей стенки, использованным для приготовления СР (относительно высокие температуры роста слоев  $T_{\text{подж}}=250$  °С и связанные с этим процессы диффузии на границах раздела  $\text{PbTe}-\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ , наличие упругих напряжений в слоях из-за несоответствия значений  $a_0$ ).

Таким образом, проведенные исследования позволили установить двумерный характер движения электронного газа в СР PbTe/Pb<sub>0.8</sub>Sn<sub>0.2</sub>Te, полученных методом горячей стенки, значительное уменьшение дифференциальной емкости, а также рост дифференциального сопротивления этих структур по сравнению с диодами или гетеропереходами Pb<sub>0.8</sub>Sn<sub>0.2</sub>Te.

#### Список литературы

- [1] Bauer G. // Surf. Sci. 1986. V. 168. N 3. P. 462—472.
- [2] Ambrosch K. E., Clemens H., Fantner E. J. et al. // Surf. Sci. 1984. V. 14. N 1-3. P. 571—578.
- [3] Сизов Ф. Ф., Троян Ю. Г., Апатская М. В., Якубцов О. А. // УФЖ. 1988. Т. 33. В. 4. С. 511—513.
- [4] Сизов Ф. Ф., Троян Ю. Г., Апатская М. В., Гуменюк-Сычевская Ж. .В. // Тез. докл. XI Всес. конф. по физике полупроводников. Кишинев, 1988. Т. 3. С. 171—172.
- [5] Allgaier R. S., Restoff J. B., Haouston B. // Phys. Rev. B. 1979. V. 19. N 16. P. 6155—6163.
- [6] Kriechbaum M., Ambrosch K. E., Fantner E. J. et al. // Phys. Rev. B. 1984. V. 30. N 6. P. 3394—3405.
- [7] Шик А. Я. // ФТИ. 1974. Т. 8. В. 10. С. 1841—1864.
- [8] Anderson W. W. // Instr. Phys. 1977. V. 17. N 1. P. 147—164.

Институт полупроводников  
АН УССР  
Киев

Получена 10.11.1988  
Принята к печати 7.03.1989